

拒絶理由通知書



特許出願の番号 特願 2003-164159
 起案日 平成16年 6月 4日
 特許庁審査官 右田 昌士 9513 2X00
 特許出願人代理人 上柳 雅誉 (外 2名) 様
 適用条文 第29条第2項

70002926
US02 公開

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項 1-5 引例 1

請求項 6-9 引例 1-3

備考

請求項 1-5 について

絶縁膜の厚さについては、引例 1 の発明の詳細な説明第 19 段落を参照。

請求項 6-9 について

反射電極上に酸化シリコンからなるパッシベーション膜を設ける構造 (周知: 例えば引例 2, 3 を参照) を引例 1 において採用し、請求項 6-9 に係る発明とすることは、当業者にとって容易である。

引用文献等一覧

引例 1: 特開平 7-84285 号公報 引例手配済 ×

引例 2: 特開平 8-179377 号公報 引例手配済

引例 3: 特開平 6-148679 号公報 引例手配済 ×

なお、この拒絶理由に不明な点がある場合、又は、この案件について面接を希

整理番号:J0100939 発送番号:207754 発送日:平成16年 6月 8日 2/E

望する場合は、特許審査第1部光デバイス(光制御) 右田(特許庁内線3293)まで
ご連絡下さい。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第 7 版 G 0 2 F 1 / 1 3 . 4 3

G 0 2 F 1 / 1 3 6 2

G 0 2 F 1 / 1 3 3 3

G 0 2 F 1 / 1 3 3 5

G 0 2 F 1 / 1 3 4 5

・先行技術文献 特開平6-95150号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。